

[A] TIIVISTELMÄ – SAMMANDRAG



S U O M I - F I N L A N D
(FI)

(11) (21) Patentihakemus – Patentansökan	894010
(51) Kv.lk.5 – Int.cl.5	
C 23C 14/52	
(22) Hakemispäivä – Ansökningsdag	25.08.89
(24) Alkupäivä – Löpdag	25.08.89
(41) Tullut julkiseksi – Blivit offentlig	26.02.91

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(71) Hakija – Sökande

1. Micronas Oy, Kamreerinkuja 2, 02770 Espoo, (FI)

(72) Keksiä – Uppfinnare

1. Tammenmaa, Markku, Kourakuja 8 C 5, 02320 Espoo, (FI)

(74) Asiamies – Ombud: Oy Kolster Ab

(54) Keksinnön nimitys – Uppfinningens benämning

Menetelmä fosforilla seostetun piidioksidikalvon kasvatusprosessin tarkkailemiseksi
Förfarande för kontrollering av en tillväxtprocess för en med fosfor dopad kiseldioxidfilm

(57) Tiivistelmä – Sammandrag

Keksinnön kohteena on menetelmä fosforilla seostetun piidioksidohutkalvon kasvatusprosessin tarkkailemiseksi, joka menetelmä käsittää näyteohutkalvon kasvattamisen tarkkailtavalla kasvatusprosessilla substraatin pinnalle ja ohutkalvon suhteellisen fosforipitoisuuden määrittämisen. Fosforipitoisuuden määrittämisen nopeuttamiseksi, yksinkertaistamiseksi ja sen tarkkuuden lisäämiseksi esillä olevassa keksinnössä näyteohutkavo kasvatetaan piitä sisältämättömästä materiaalista valmistetulle substraatille, jolloin on mahdollista mitata röntgenfluoresenssimenetelmällä erikseen sekä fosforin että piin fluoresensisäteilyn intensiteetit ja määrittää fosforin suhteellinen osuus ohutkalvoissa näiden mitattujen intensiteettien suhteen. Menetelmä kalibroidaan valmistamalla samanlaiselle substraatille tunnetut profili/pii-suhteet sisältävät standardikalvot.

Uppfinningen avser ett förfarande för kontroll av tillväxtprocessen i en med fosfor dopad kiseldioxidfilm, vilket förfarande omfattar framställning av en provtunnfilm på ytan av ett substrat medelst den tillväxtprocess, som skall kontrolleras, och bestämning av tunnfilms relativa fosforhalt. För att göra snabbare och förenkla bestämningen av fosforhalten och därvid höja precisionen framställs i föreliggande uppfinning en provtunnfilm på ett substrat, som ej innehåller kisel, varvid det är möjligt att medelst röntgenfluorescensförfarande särskilt mäta fluorescensstrålningens intensitet såväl i fosforn som i kiseln och bestämma fosforns relativt andel i tunnfilmen i förhållande till dessa mätta intensiter. Förfarandet kalibreras genom framställning av standardfilmer med kända profil/kisel-förhållanden på samma slags substrat.

